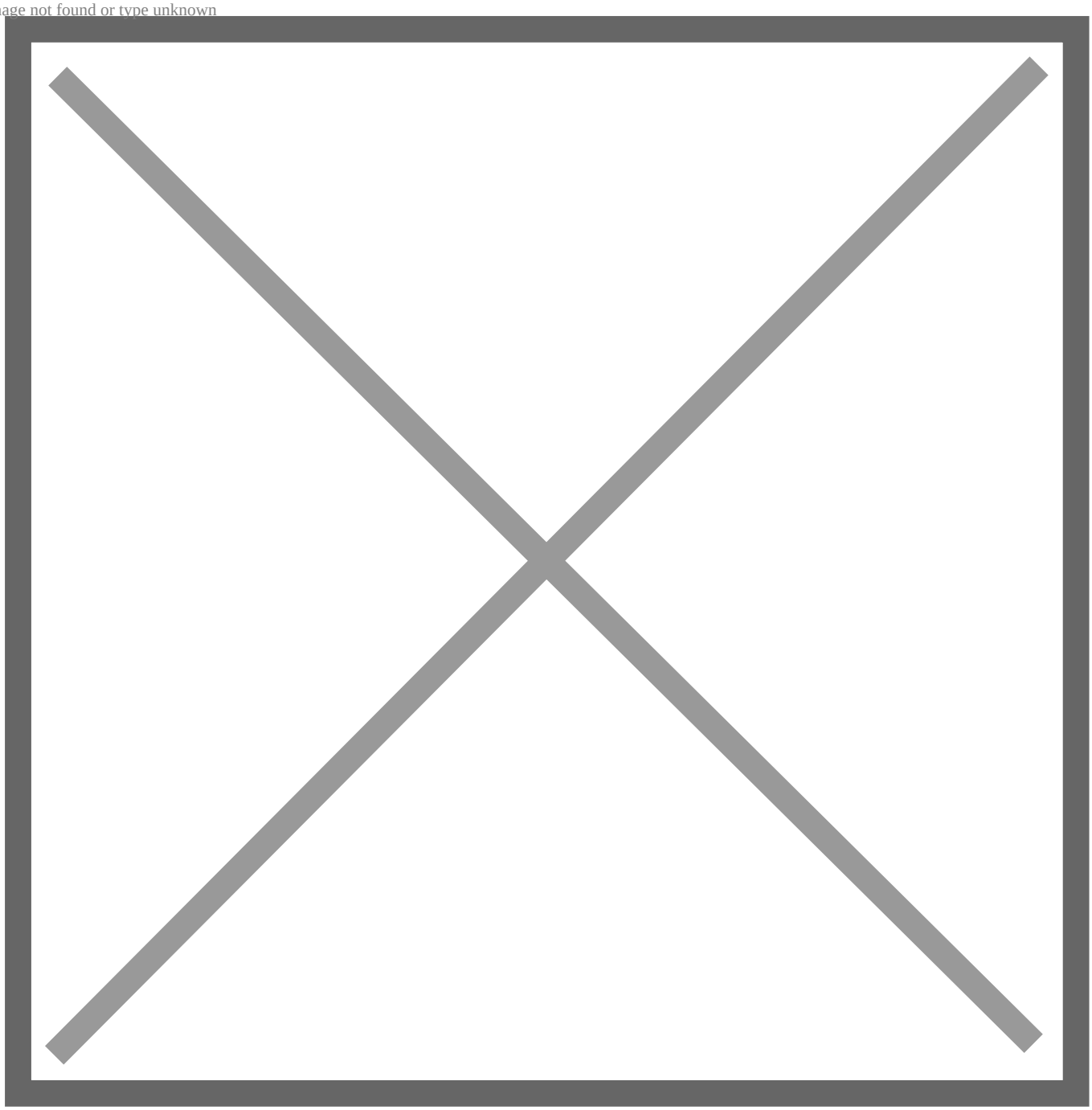
ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Установка атомно-слоевого осаждения Shell

Image not found or type unknown



Производитель:	Цена:
CN1	Цена по запросу

Описание

Установка Shell предназначена для процессов атомно-слоевого осаждения тонких пленок на порошковые или гранулированные материалы. Загрузка

порошка в рабочую камеру осуществляется вручную. Имеется встроенная система подачи прекурсоров, а также привод вращения рабочей камеры для равномерного осаждения пленки. Установка Shell подходит для создания и исследования новых нанопорошков.

Область применения

- Нанотехнологии и наноматериалы.
- Нанокатализаторы и функциональные материалы.
- Нанопорошки.
- Обработка порошковых материалов.

Особенности

- Специальная конструкция рабочей камеры обеспечивает равномерное осаждение тонких пленок на порошковые материалы.
- Регулируемая температура камеры 25 – 300°C.
- До 4 линий подачи прекурсоров.
- Простое сервисное обслуживание благодаря модульной конструкции установки.
- Совместимость с условиями чистых помещений.

Параметр	Значение
Загрузка	Ручная (open load)
Объем рабочей камеры	100 – 500 см^3 (в зависимости от применения)
Температура нагрева камеры	25 - 300°C
Линии подачи прекурсоров	4 линии: 3 подогреваемые до 150˚C 1 без подогрева
Рабочие газы	Встроенный газовый шкаф с цифровыми РРГ
Вакуумная система Предельное давление Контроль давления	Сухая откачная система с подогревом Автоматический
Система управления	ПЛК и сенсорный дисплей с GUI-интерфейсом